

SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS

ABSTRACT

洗浄部において基板を搬送するための機構を洗浄する。

基板研磨装置と、基板洗浄部と、を備える、基板処理装置であって、基板洗浄部は、洗浄モジュールと、洗浄部搬送機構と、を備え、洗浄部搬送機構は、ハンドと、ハンド開閉機構と、を備え、基板処理装置はさらに、ハンド洗浄部を備え、ハンド洗浄部は、ハンド洗浄槽と、洗浄液噴射機構と、を備えている、基板処理装置を開示する。

Figure 1